

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 24 年 11 月 22 日 (2012.11.22)

【公開番号】特開 2011-82260 (P2011-82260A)

【公開日】平成 23 年 4 月 21 日 (2011.4.21)

【年通号数】公開・登録公報 2011-016

【出願番号】特願 2009-231637 (P2009-231637)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/302 1 0 5 A

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 10 月 5 日 (2012.10.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 3】

エッチング層 2 の材料としては、各種ドライエッチングに用いられるエッチング材料を用いることができる。これらのエッチング材料の中でも、エッチングを一方向（異方的）に進行させ、アスペクト比を向上させる観点から、 $\text{Si}$ 、 $\text{SiO}_{x_1}$ （ $x_1$  は、 $0 < x_1 \leq 2$  である。）や  $\text{SiN}_{x_2}$ （ $x_2$  は、 $0 < x_2 < 0.75$  である。）などの無機化合物から選ばれる材料を用いる。これらの中でも  $\text{SiO}_2$  が好ましい。